

נסח מפנקס הפטנטים
Extract from Register of Patents

Patent No: 157506 **מספר פטנט:**

Title of invention: **שם האמצאה:**
METHOD OF FABRICATING LOW-DIELECTRIC CONSTANT INTERLEVEL DIELECTRIC FILMS FOR BEOL INTERCONNECTS WITH ENHANCED ADHESION AND LOW-DEFECT DENSITY
שיטה לייצור שכבות דיאלקטריות בעלות מקדם דיאלקטרי נמוך, עבור מוליכים על שבבי סיליקון שהן בעלות אדהזיה משופרת וצפיפות פגמים נמוכה

Date of application: 19/02/2002 **תאריך הבקשה:**

National Phase Entry: 21/08/2003 תאריך כניסה לשלב הלאומי:

International Application No: PCT/US/2002/004879 בקשת פטנט בינלאומי מס':

International Publication No: WO/2002/069381 פרסום בינלאומי מס':

Patent in force until the: 19/02/2012 **הפטנט בתוקף עד:**

Priority Right:				דין קדימה:
	US	21/02/2001	09/789422	
Patentee(s):				בעלי הפטנט:
IBM CORPORATION				
Customer No:	202881			קוד לקוח:
NEW ORCHARD ROAD, ARMONK, N.Y. 10504 U.S.A.				
Address for service:				המען למסירת הודעות:
Main representative:				מיופה כח ראשי:
YOR9-2000-0214PCT				
IBM LABORATORIES				מעבדות יבמ
HAIFA UNIVERSITY HAIFA 31905 Israel				31905אוניברסיטת חיפה הר הכרמל חיפה
Current status:				סטטוס נוכחי:
Second renewal		10/10/2010		חידוש שני
Statuses history:				היסטוריית סטטוסים:
First renewal		10/10/2010		חידוש ראשון
Request for reinstatement of patent validation		11/08/2009		בקשה להחזר תוקף
Patent not in force	9/2010	04/12/2007		פקיעת תוקף
Patent not in force	6/2008	04/12/2007		פקיעת תוקף
Patent granted	8/2007	04/09/2007		ניתן פטנט
Second publication		03/06/2007		בפרסום שני
redy for publication in journal number	2/2007	20/02/2007		מוכן לפרסום שני ומצויין יומן
First publication		28/03/2004		פרסום ראשון
Ready for first publication		08/02/2004		מאושר לפרסום ראשון
Ready for first publication	1/2004	08/02/2004		מאושר לפרסום ראשון